104/37-05-00

JC06 Rec'd PCT/PTO 27 MAY 2005

VERIFICATION

The undersigned, of the below address, hereby certifies that he/she well knows both the English and Japanese languages, and that the attached is an accurate English translation of the PCT application filed on August 6, 2004 under No. PCT/JP2004/011679.

The undersigned declares further that all statements made herein of his/her own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issuing thereon.

Signed this \ day of May, 2005

Signature:

Kenichi TAKAHASHI

Konichi Takahashi

Address:

c/o Osaka Works of

SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD. 1-3, Shimaya 1-chome, Konohana-ku, Osaka-shi,

Osaka, Japan

(12)特別

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



. | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1884 | 1884 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1

(43) 国際公開日 2005 年3 月31 日 (31.03.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/029512 A1

- (51) 国際特許分類⁷: **H01B 13/00**, 12/06, H01L 39/24, C23C 14/08, C01G 3/00, 1/00, 25/00
- (21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/011679

(22) 国際出願日:

2004年8月6日 (06.08.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

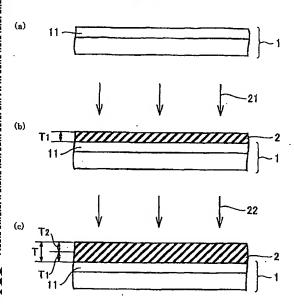
特願2003-324167 2003 年9 月17 日 (17.09.2003) J

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 住友電 気工業株式会社 (SUMITOMO ELECTRIC INDUS-TRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒5410041 大阪府大阪市中央区 北浜四丁目5番33号 Osaka (JP).

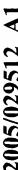
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 母倉 修司 (HA-HAKURA, Shuji) [JP/JP]; 〒5540024 大阪府大阪市此花区島屋一丁目1番3号 住友電気工業株式会社 大阪製作所内 Osaka (JP). 大松 一也 (OHMATSU, Kazuya) [JP/JP]; 〒5540024 大阪府大阪市此花区島屋一丁目1番3号住友電気工業株式会社 大阪製作所内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 中野 稔 , 外(NAKANO, Minoru et al.); 〒 5540024 大阪府大阪市此花区島屋一丁目 1番 3号 住 友電気工業株式会社内 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,

/続葉有/

- (54) Title: SUPERCONDUCTOR AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME
- (54) 発明の名称: 超電導体およびその製造方法



- (57) Abstract: A process for producing a superconductor in which a superconductive layer is formed on an underlying layer by repeating film deposition two or more times. Film thickness of a superconductive film formed by each deposition is set at 0.3 μ m or less so that decrease in JC is small even when the thickness of the superconductive layer is large, thereby increasing IC of the superconductor.
- (57) 要約: 下地層に2回以上の成膜により超電導層を形成する超電導体の製造方法であって、各回の成膜における超電導膜の膜厚を0. 3 μ m以下とし、超電導層の層厚を大きくしても J c の減少が小さく、 I c が増大する超電導体およびその製造方法を提供する。



(d)

WO 2005/029512 A1

NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,

BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類: 一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。